

卓上型多項目水質分析計

HS-2300 Plus

●優れた特徴

1. 42種類の水質成分分析計をB5サイズ大のコンパクトなボディに凝縮!!
2. 専用の反応試薬キットにサンプルを入れるだけの簡単分析

42項目の測定が可能

低コスト試薬

残留塩素測定

COD測定

全リン・全窒素測定

地下水多項目測定

- バッテリー駆動(残量表示付)
- プリンター接続可能
- 低価格



T&C
Technical

HS-2300Plus

●HS-2300Plus仕様

表示画面	LCD(128*64ドット)16×4ライン
測定手法	吸光光度法
光源	LEDランプ(365, 410, 470, 525, 605, 850nm)
インターフェイス	専用プリンターポート
寸法	250(W)×200(D)×85(H)mm 突起物除く
重量	1.2kg
電源	AC100~240V 50/60Hz バッテリー(Li-ion 3.7V-1400mA)
駆動時間	3時間(バッテリー使用時)
機能	LCD自動OFF機能、日付・時計機能、 専用プリンタ出力
専用オプション	前処理装置 HS-R200 専用サーマルプリンター HS-P100



反応試薬キット



前処理装置 HS-R200



専用サーマルプリンター HS-P100

No.	反応試薬キット	分析項目	測定範囲(mg/l)	測定誤差*	前処理装置*
1	HS-Cl ₂ (T)	全塩素	0.01~2.00	±5%	—
2	HS-Cl ₂ (Free)	遊離塩素	0.01~2.00	±5%	—
3	HS-TN-U	全窒素(超低濃度)	0.20~5.00	±5%	○
4	HS-TN-L	全窒素(低濃度)	1.00~50.0	±5%	○
5	HS-TN-H	全窒素(高濃度)	10.0~100	±5%	○
6	HS-TP-L	全リン(低濃度)	0.01~3.00	±5%	○
7	HS-TP-H	全リン(高濃度)	1.00~15.0	±5%	○
8	HS-COD-U	COD-Cr(超低濃度)	5.00~40.0	±5%	○
9	HS-COD-L	COD-Cr(低濃度)	15.0~150	±5%	○
10	HS-COD-M	COD-Cr(中濃度)	50.0~1500	±5%	○
11	HS-COD-H	COD-Cr(高濃度)	500~15000	±5%	○
12	HS-COD(Mn)-U	COD-Mn(超低濃度)	0.20~3.00	±5%	○
13	HS-COD(Mn)-L	COD-Mn(低濃度)	2.00~20.0	±5%	○
14	HS-COD(Mn)-H	COD-Mn(高濃度)	20.0~100	±5%	○
15	HS-Al	アルミニウム	0.01~0.30	±5%	—
16	HS-F	フッ素	0.10~1.50	±5%	—
17	HS-Fe(T)	全鉄	0.10~5.00	±5%	—
18	HS-Fe(+2)	酸化鉄	0.10~5.00	±5%	—
19	HS-HD(Ca, Mg)	全硬度	0.10~4.00	±5%	—
20	HS-Zn	亜鉛	0.10~5.00	±5%	—
21	HS-S	硫化物	0.50~5.00	±5%	—
22	HS-SO ₄ -L	硫酸塩(低濃度)	5.00~50.0	±5%	—
23	HS-SO ₄ -H	硫酸塩(高濃度)	10.0~70.0	±5%	—
24	HS-NO ₃ (N)-L	硝酸態窒素(低濃度)	0.20~5.00	±5%	—
25	HS-NO ₃ (N)-H	硝酸態窒素(高濃度)	0.50~30.0	±5%	—
26	HS-NO ₂ (N)-L	亜硝酸態窒素(低濃度)	0.10~1.00	±5%	—
27	HS-NO ₂ (N)-H	亜硝酸態窒素(高濃度)	10.0~150	±5%	—
28	HS-Cu	銅	0.10~5.00	±5%	—
29	HS-Cr(T)	全クロム	0.10~1.00	±5%	○
30	HS-Cr(+6)	6価クロム	0.10~1.00	±5%	—
31	HS-CN	シアン化合物	0.005~0.50	±5%	○
32	HS-Cl-L	塩化物(低濃度)	1.00~20.0	±5%	—
33	HS-Cl-H	塩化物(高濃度)	20.0~60.0	±5%	—
34	HS-NH ₄ (N)-U	アンモニア態窒素(超低濃度)	0.03~1.00	±5%	○
35	HS-NH ₄ (N)-L	アンモニア態窒素(低濃度)	0.20~6.00	±5%	—
36	HS-NH ₄ (N)-H	アンモニア態窒素(高濃度)	2.00~60.0	±5%	—
37	HS-PO ₄ (P)-L	リン酸塩(低濃度)	0.01~3.00	±5%	—
38	HS-PO ₄ (P)-H	リン酸塩(高濃度)	1.00~15.0	±5%	—
39	HS-B-L	ホウ素(低濃度)	0.20~3.00	±5%	—
40	HS-B-H	ホウ素(高濃度)	3.00~15.0	±5%	—
41	HS-Si-L	シリカ(低濃度)	0.50~20.0	±5%	—
42	HS-Si-H	シリカ(高濃度)	20.0~100	±5%	—

※…測定誤差:フルスケール値 ★…前処理装置HS-R200が必要

※本カタログの内容は製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせは、下記の取り扱い会社までお申し出下さい。

株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル

〒120-0036 東京都足立区千住仲町40番12号 プラティネールビル 2F
TEL.03-3870-7101(代) FAX.03-3870-7102

<http://www.tactec.co.jp>

代理店